

## KOREAPAT

KOREAPAT は、KIPO（韓国特許庁）の一部門である KIPI（Korean Institute of Patent Information：韓国特許情報院）が提供する韓国特許のデータベースです。情報は全て英語で記述されています。

当ファイルは韓国で発行された 1979-2001 年の公告特許および 2000 年以降の公開特許を収録しています。英語標題、抄録（KIPI 作成）に加えて、発明者、特許出願人、特許番号類、国際特許分類を収録しています。代表図面も収録しています。

## 収録内容

科学技術分野全般

## 収録源

Korean Patent abstracts (CD ROM), 審査済および未審査特許

## ファイル内容

1979 年から現在まで（公開特許（A- 特許）は 2000 年以降、公告特許（B- 特許）は 1979-2001 年まで）  
レコード数 1,374,000 件以上（2011 年 7 月現在）  
イメージ数 1,257,000 件以上（2011 年 7 月現在）  
更新は毎月  
アラート（自動 SDI 検索）は毎月実施

## 検索補助資料

オンラインヘルプ（HELP DIRECTORY で利用できるすべてのヘルプメッセージが表示されます）  
STNGUIDE

## データベース製作者

Korean Institute of Patent Information (KIPI)  
6-8 th Fl. KIPS 647-9 Yeoksam-dong  
2Gangnam-ku, Seoul 135-980  
Korea  
Phone: (+82) 2 3452 8144  
Fax: (+82) 2 3453 5953  
著作権所有者

## データベース提供者

FIZ Karlsruhe  
P. O. Box 2465  
D-76012 Karlsruhe  
Germany  
Phone: (+49) 7247/808-555  
Fax: (+49) 7247/808-259  
E-mail: helpdesk@fiz-karlsruhe.de

## ヨーロッパ

### STN カールスルーエ

FIZ Karlsruhe  
P.O. Box 2465  
76012 Karlsruhe  
Germany  
Phone: +49-7247-808-555  
Fax: +49-7247-808-259  
E-mail: helpdesk@fiz-karlsruhe.de  
Internet: www.stn-international.de

## 日本

### STN 東京

### 一般社団法人 化学情報協会

〒113-0021 東京都文京区本駒込6-25-4 中居ビル  
Phone: 0120-003-462 (Help Desk)  
: 0120-151-462 (上記以外)  
Fax: 03-5978-4090  
E-mail: support@jaici.or.jp (Help Desk)  
customer@jaici.or.jp (上記以外)  
Internet: www.jaici.or.jp

## 北アメリカ

### STN コロンバス

CAS  
P.O. Box 3012  
Columbus, Ohio 43210-0012 U.S.A  
CAS Customer Care:  
Phone: 800-753-4227 (North America)  
614-447-3700 (worldwide)  
Fax: 614-447-3751  
E-mail: help@cas.org  
Internet: www.cas.org

## SEARCHおよびDISPLAYフィールド

中間一致および後方一致検索可能なフィールド(/BI)はアスタリスク(\*)で示してあります。

| フィールド  | SEARCH<br>コード | SEARCH 例  | DISPLAY<br>コード |
|--|---------------|---|----------------|
| 基本索引 * 1)<br>標題 (/TI)<br>抄録 (/AB)<br>(以上からの切出し語) | なし<br>または/BI  | S ?PHENYLETHER?<br>S MODEL?<br>S FLUID AND EMULSION | TI, AB         |
| 抄録   | /AB           | S LADER/AB  | AB             |
| レコード番号   | /AN           | S 2004:000001/AN                                    | AN             |
| 出願国<br>(WIPO コードおよび国名)                           | /AC           | S KR/AC AND L1                                      | AI             |
| 出願日 2)   | /AD           | S JUL-SEP 1995/AD                                   | AI             |
| 出願番号 3),4)                                       | /AP           | S KR2000-10007/AP<br>S KR1020000000007/AP           | AI, APO        |
| 出願番号, オリジナル形式                                    | /APO          | S KR1020000000007/APO                               | APO            |
| 出願番号グループ 6)                                      | /AP, /PRN     | S KR2000-1001/APPS                                  | AI, PRAI       |
| 出願年 2)   | /AY           | S 1999-2000/AY                                      | AI             |
| 資料種類   | /DT           | S P/DT  | DT             |
| (コードおよびテキスト)                                     | または/TC        | S PATENT/DT   |                |
| 入力日 2)   | /ED           | S ED=AUG 2004                                       | ED             |
| または/UP   |               |   |                |
| フィールドの存在   | /FA           | S GI/FA   | FA             |
| 図面イメージ容量 2)                                      | /GIS          | S GIS<=350  | GIS            |
| 図面イメージ種類   | /GIT          | S TIF/GUT   | GIT            |
| 国際特許分類   | /IC           | S A24B/IC   | IC             |
| または/IPC  |               |   |                |
| 発明者  | /IN           | S MANDEL?/IN  | IN, AU         |
| または/AU   |               | S SATO AKIHIRO/IN                                   |                |
| 国際特許分類, 主分類                                      | /ICM          | S A01N001/ICM<br>S A01B059-06/ICM                   | ICM, IC        |
| 国際特許分類, 副分類                                      | /ICS          | S A01G023/ICS                                       | ICS, IC        |
| 国際特許分類, 主分類グループ 2)                               | /MGR          | S 10-20/MGR(S)C07C/IC                               | ICM, ICS       |
| (範囲指定検索用)  |               |   |                |
| 国際特許分類, 副分類グループ 2)                               | /SGR          | S C01B/ICM(S)100-2000/SGR                           | ICM, ICS       |
| (範囲指定検索用)  |               |   |                |
| 特許出願人 5)   | /PA           | S HITACHI/PA  | PA             |
| または/CS   |               | S NIPPON CHEM?/PA                                   |                |
| 特許発行国<br>(WIPOコードおよび国名)                          | /PC           | S KR/PC   | PI, PNO        |
| 特許種別コード  | /PK           | S KRA/PK  | PI             |
| 特許番号 3),4)                                       | /PN           | S KR200027/PN<br>S KR100200027/PN                   | PI, PNO        |
| または/PATS   |               |   |                |
| 特許番号, オリジナル形式                                    | /PNO          | S KR100200027/PNO                                   | PNO            |
| 優先権主張国<br>(WIPO コードおよび国名)                        | /PRC          | S US/PRC<br>S UNITES STATES/PRC                     | PRAI           |
| 優先権主張日 2)  | /PRD          | S JAN-APR 2004/PRD                                  | PRAI           |
| 優先権出願番号 3),4)                                    | /PRN          | S AT1985-25617/PRN                                  | PRAI           |
| 優先権出願番号, オリジナル形式                                 | /PRNO         | S UK48367/PRNO                                      | PRNO           |
| 優先権出願の種類   | /PRT          | S INTERNATIONAL APPLICATION/PRT                     | 表示されない         |
| 優先権主張年 2)  | /PRY          | S 2003=PRY  | PRAI           |
| 特許発行日 2)   | /PD           | S PD=FEB 1995                                       | PI             |
| 特許発行年 2)   | /PY           | S PY>=2003 AND L2                                   | PI             |
| 標題   | /TI           | S SUPPLYING OXYGEN/TI                               | TI             |
| 標題の言語  | /TL           | S ENGLISH/TL  | TL             |

(続く)

## SEARCHおよびDISPLAYフィールド

| フィールド             | SEARCH<br>コード | SEARCH 例             | DISPLAY<br>コード |
|-------------------|---------------|----------------------|----------------|
| 更新日 <sup>2)</sup> | /UP<br>または/ED | S L1 AND UP=JAN 2004 | ED             |

- 1) このフィールドでは前方一致検索に加えて、中間一致および後方一致検索が可能です。語幹には少なくとも4文字が必要です。
- 2) 数値演算子あるいは範囲指定検索による検索が可能な数値検索フィールドです。
- 3) 出願番号および特許番号はダウエント形式およびSTN形式が利用できます。STN形式がデフォルトです。ダウエント形式への変換はSET PAT DERWENTと入力します。STN形式に戻す場合にはSET PAT STNと入力します。
- 4) このフィールドには、オリジナルの出願番号（あるいはオリジナルの原特許番号）の入力形式も含まれています。
- 5) このフィールドでは、(S)演算子をスペースで代用できます。
- 6) このフィールドは、/APおよび/PRNを検索するためのスーパーサーチフィールドです。このフィールドではEXPANDを利用できません。個々のフィールド (/AP, /PRN) でEXPANDしてください。

## DISPLAYおよびPRINT形式

回答のディスプレイとオフラインプリントには下記の表示形式を自由に組み合わせることができます。複数のコードは、“D L1 1-5 TI IN”のようにスペースやカンマで区切ってください。フィールドは指定された順序で表示されます。

すべての検索フィールドでヒットタームハイライト機能が使えます。ハイライト機能をご利用にならない場合にはSET HIGHLIGHT OFFと入力してください。システムのデフォルトはONになっています。HIT, KWIC, OCC表示形式を使うためには、検索時にハイライト機能がONになっていることが必要です。

| 形式                       | 英語名  | 内容                | 入力例    |
|--------------------------|--|-------------------|--------|
| AB                       | Abstract                                       | 抄録                | D AB   |
| AI (AP) <sup>2)</sup>    | Application Information                        | 出願情報              | D AP   |
| AN                       | Accession Number                               | レコード番号            | D AN   |
| APO                      | Application Number, Original                   | 出願番号, オリジナル形式     | D APO  |
| APPS                     | Application Number Group                       | 出願番号グループ          | D APPS |
| DT (TC)                  | Document Type                                  | 資料種類              | D DT   |
| ED (UP)                  | Entry Date                                     | 入力日               | D ED   |
| FA <sup>1)</sup>         | Field Availability                             | フィールドの存在          | D FA   |
| GI <sup>1),3)</sup>      | Graphic Image                                  | 図面イメージ            | D GI   |
| GIS <sup>1)</sup>        | Graphic Image Size                             | 図面イメージ容量          | D GIS  |
| GIT <sup>1)</sup>        | Graphic Image Type                             | 図面イメージ種類          | D GIT  |
| IC (IPC)                 | International Patent Classification (ICM, ICS) | 国際特許分類 (主分類, 副分類) | D IC   |
| ICM                      | IPC, Main                                      | 国際特許分類, 主分類       | D ICM  |
| ICS                      | IPC, Secondary                                 | 国際特許分類, 副分類       | D ICS  |
| IN (AU)                  | Inventor                                       | 発明者               | D IN   |
| PA (CS)                  | Patent Assignee                                | 出願人               | D PA   |
| PATS (PN) <sup>1)</sup>  | Patent Number Group                            | 特許番号グループ          | D PATS |
| PI (PN)                  | Patent Information                             | 特許情報              | D PI   |
| PIT                      | Patent Information Publication Type            | 特許情報, 公開のタイプ      | D PIT  |
| PK                       | Patent Kind Code                               | 特許種別              | D PK   |
| PNO <sup>1)</sup>        | Patent Number, Original                        | 特許番号, オリジナル形式     | D PNO  |
| PRAI (PRN) <sup>2)</sup> | Priority Information                           | 優先権出願情報           | D PRAI |
| PRNO <sup>1)</sup>       | Priority Number, Original                      | 優先権出願情報, オリジナル形式  | D PRNO |
| TI <sup>1)</sup>         | Title (contains title language)                | 標題 (標題言語を含む)      | D TI   |
| UP                       | Update Date                                    | 更新日               | D UP   |

(続く)

## DISPLAYおよびPRINT形式

| 形式                                   | 内容   | 入力例       |
|--------------------------------------|--|-----------|
| ABS                                  | AN, AB   | D ABS     |
| ALL (MAX) <sup>2)</sup>              | AN, ED, TI, IN, PA, PIT, PI, AI, PRAI, IC, AB          | D ALL     |
| ALLG <sup>2),3)</sup>                | AN, ED, TI, IN, PA, PIT, PI, AI, PRAI, IC GI AB        | D ALLG    |
| BIB <sup>1)</sup>                    | AN, ED, TI, IN, PA, PIT, PI, AI, PRAI                  | D BIB     |
| DALL <sup>2)</sup>                   | デリミタ型ALL形式   | D DALL    |
| IALL (IMAX) <sup>2)</sup>            | フィールド名付きインデント型ALL形式                                    | D IALL    |
| IALLG <sup>2),3)</sup>               | フィールド名付きインデント型ALLG形式                                   | D IALLG   |
| IBIB <sup>2)</sup>                   | フィールド名付きインデント型BIB形式                                    | D IBIB    |
| IND                                  | AN, IPC  | D IND     |
| ISTD <sup>2)</sup>                   | フィールド名付きインデント型STD形式                                    | D ISTD    |
| MAXG <sup>2),3)</sup>                | AN, ED, TI, IN, PA, PIT, PI, AI, PRAI, IC, GIS, GI, AB | D MAXG    |
| SAMPLE<br>(SAM, TRIAL,<br>TRI, FREE) | AN, TI, IC   | D SAM     |
| SCAN <sup>4)</sup>                   | TI (回答番号無しのランダム表示)                                     | D SCAN    |
| STD <sup>2)</sup>                    | AN, ED, TI, IN, PA, PIT, PI, AI, PRAI, IC              | D STD     |
| HIT                                  | ヒットタームを含むフィールド   | D HIT     |
| KWIC                                 | ヒットタームの前後20語を表示 (KeyWord-In-Context)                   | D KWIC    |
| OCC                                  | ヒットタームの出現頻度をフィールドごとに表示                                 | D OCC 1-6 |

1) カスタム形式のみの表示です。

2) 出願番号および特許番号はダウエント形式およびSTN形式が利用できます。STN形式がデフォルトです。ダウエント形式への変換はSET PAT DERWENTと入力します。STN形式に戻す場合にはSET PAT STNと入力します。

3) G4 FAX形式に圧縮されたTIFFおよびJPEGイメージを扱うプログラムであるSTN Expressなどでは、DISPL AYコマンドによりイメージをいったんダウンロードします。STN on the Webでは、イメージを直接画面に表示することができます。

4) SCAN形式は、コマンドに続けて入力します。例: D SCAN または DISPLAY SCAN

## SELECT, ANALYZEおよびSORTフィールド

SELECTコマンドは、回答セットの指定したフィールドから抽出した語句にE番号を付与します。

ANALYZEコマンドは、回答セットの指定したフィールドから抽出した語句にL番号を付与します。

SORTコマンドは、検索結果を指定したフィールドのアルファベット順または数値順に並べ替えます。

(該当項目はY, 該当しないものはNで表示されています。)

| フィールド             | フィールドコード | ANALYZE/SELECT <sup>1)</sup> | SORT |
|-------------------|----------|------------------------------|------|
| 抄録                | AB       | Y                            | Y    |
| 出願国               | AC       | Y                            | N    |
| 出願日               | AD       | Y                            | N    |
| レコード番号            | AN       | Y                            | Y    |
| 出願番号              | AP (AI)  | Y                            | Y    |
| 出願番号, オリジナル形式     | APO      | Y                            | Y    |
| 出願番号グループ          | APPS     | Y                            | Y    |
| 出願年               | AY       | Y                            | N    |
| 資料種類              | DT (TC)  | Y                            | Y    |
| 入力日               | ED       | Y                            | Y    |
| フィールドの存在          | FA       | Y                            | N    |
| 素面イメージ容量          | GIS      | Y                            | N    |
| 図面イメージ種類          | GIT      | Y                            | Y    |
| 発明者               | IN (AU)  | Y                            | Y    |
| 国際特許分類 (ICM, ICS) | IPC      | Y                            | Y    |
| 国際特許分類 (主分類, 副分類) | IC       | Y                            | N    |

(続く)

## SELECT, ANALYZEおよびSORTフィールド

| フィールド            | フィールドコード   | ANALYZE/SELECT <sup>1)</sup> | SORT |
|------------------|------------|------------------------------|------|
| 国際特許分類, 主分類      | ICM        | Y                            | Y    |
| 国際特許分類, 副分類      | ICS        | Y                            | Y    |
| 特許出願人            | PA (CS)    | Y                            | Y    |
| 特許番号グループ         | PATS       | Y                            | N    |
| 特許発行国            | PC         | Y                            | Y    |
| 特許情報             | PI         | Y                            | Y    |
| 特許種別             | PK         | Y                            | Y    |
| 特許番号             | PN (PI)    | Y                            | Y    |
| 特許番号, オリジナル形式    | PNO        | Y                            | N    |
| 優先権主張国           | PRC        | Y                            | Y    |
| 優先権主張日           | PRD        | Y                            | Y    |
| 優先権出願情報          | PRAI       | Y                            | Y    |
| 優先権出願番号          | PRN (PRAI) | Y                            | Y    |
| 優先権出願番号, オリジナル形式 | PRNO       | Y                            | N    |
| 優先権出願タイプ         | PRT        | Y                            | N    |
| 優先権主張年           | PRY        | Y                            | Y    |
| 特許発行日            | PD         | Y                            | Y    |
| 特許発行年            | PY         | Y                            | Y    |
| 標題               | TI         | Y (デフォルト)                    | Y    |
| 標題言語             | TL         | Y                            | Y    |
| 更新日              | UP         | Y                            | Y    |

1) ヒットタームだけを抽出させるには, HITを使います. 例: SEL HIT IN

## サンプルレコード

## MAXG形式での表示

```

AN  2004:017120  KOREAPAT  ED 20040819
TI  INTEGRATED DEVELOPER OF WET COLOR LASER PRINTER
TL  English
IN  SHIN, HYEON SEONG
PA  SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
PIT KRA Unexamined Patent Application
PI  KR 2004024813      A      20040322
AI  KR 2002-56262      20020916
PRAI KR 2002-056262 *      20020916
IC
ICM G03G015-10
GIS 17524
AB  PURPOSE: An integrated developer of a wet color laser printer is provided
to cut off a waste developer storage entrance so that a waste developer
stored in a waste developer storage does not flow back through the
entrance, thereby preventing the waste developer from flowing out.
CONSTITUTION: A photosensitive drum(20) has an electric charge layer, and
forms a predetermined electrostatic latent image. A developing roller(30)
moves a developer to the photosensitive drum(20) to develop the
electrostatic latent image as a visual image. An upper end of a cleaning
blade(50) is contacted with the photosensitive drum(20) to remove a
remaining waste developer. A developing cartridge(10) receives the
photosensitive drum(20), the developing roller(30), and the cleaning
blade(50). The developing cartridge(10) is divided into a developer
storage(1) and a waste developer storage(2). The developer storage(1)
stores the developer. The waste developer storage(2) stores the waste
developer removed by the cleaning blade(50). A leakage prevention
member(80) cuts off an entrance of the waste developer storage(2) so that
the waste developer does not flow back through the entrance.
.COPYRGT. KIPO 2004

```